

高純度スパッタリングターゲットの製造技術開発

開発のねらい

従来、高性能TMR素子形成に使用されてきた高純度MgOターゲットの次世代用ターゲットの製造技術を開発する。

開発の概要

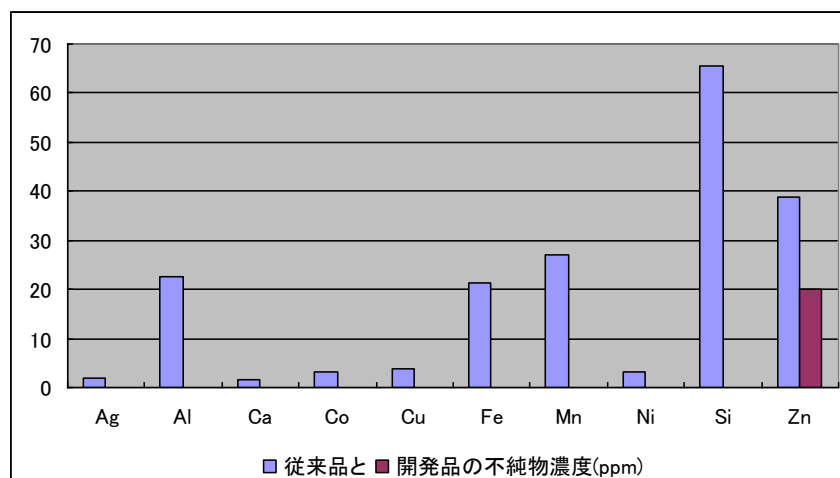
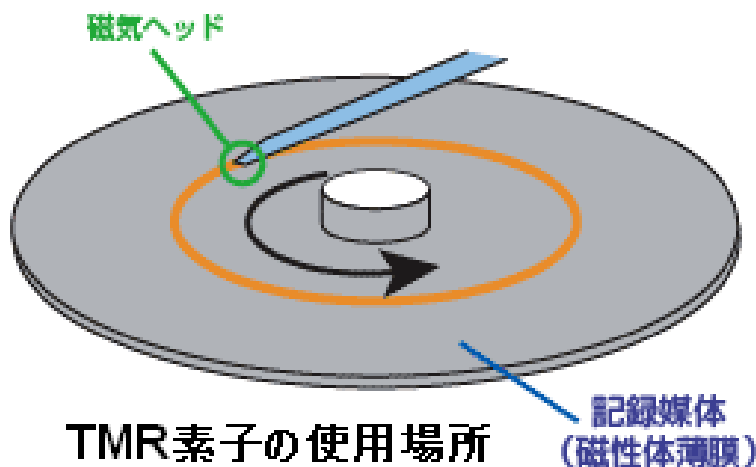
- ・金属素材を原材料として超高純度Mg原料を開発する。
- ・高純度原料により超高純度スパッタリングターゲットを開発する。
- ・超高純度ターゲットの純度分析・評価技術を開発する。

特長

・所定の製造・分析・評価技術を開発することで、従来のスパッタリングターゲットに比較して10～50倍高い純度を有する。

用途

・超高純度スパッタリングターゲットは高いMR比、低いRA値が要求される次世代のTMR素子の成膜に使用される。



お問い合わせ先

【所在地】 〒350-0284 埼玉県坂戸市千代田5-1-28

【連絡先】 TEL 049-284-1511 sales@kojundo.co.jp 池田・河村

